

USTR、2019年外国貿易障壁報告書を発表

2019年4月25日
JETRO NY 知的財産部
柳澤、笠原

米国通商代表部（USTR）は3月29日、2019年外国貿易障壁報告書「National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers」¹を発表した。

報告書は、世界中の貿易障壁を対象にするものの、特に中国に焦点を当てているとしており、産業政策や知的財産に関して貿易障壁となるものとして以下のようないいものが挙げられている。

➤ 産業政策

関税、技術移転、産業政策プラットフォーム「Made in China 2025」、先住民のイノベーション、投資制限、情報通信技術政策、暗号化、補助金、過剰生産能力、輸出規制、付加価値税還付及び関連政策、再生品輸入禁止、回収可能製品輸入禁止、標準、化粧品

➤ 知的財産

営業秘密、悪意の商標登録、医薬品、オンライン侵害、模造品

USTRは、中国の産業政策について、中国政府が技術系の国内企業を守るために使う政策（産業政策プラットフォーム「Made in China 2025」で記される強制技術移転など）を非難しており、その中で、「中国での事業実施を計画する外国企業から、機密性の高い知的財産とビジネス情報が、一連の投資制限を用いて中国企業により抽出されている」などとしている。

また、オンライン侵害に対し、「2019年1月に施行された新たな電子商取引法では、特許権者がオンライン上で権利を保護する能力を弱め、中国における電子商取引プラットフォームが模造品やその他の侵害品の販売に対して責任を負うことにより困難にする規定を導入した」として非難している。

なお、日本の知的財産権保護に対しては、デジタル環境での著作権侵害を防ぐ方法の採用を通じた著作権侵害率の引き下げ等が求められているが、産業財産権（特許、実用新案、意匠、商標）に関する言及はない。

（以上）

¹ https://ustr.gov/sites/default/files/2019_National_Trade_Estimate_Report.pdf